

Samsung recibe maquinaria de alta AN de ASML, competirá con Intel en producir primera los chips más avanzados

Algunos de los primeros escáneres fotolitografía de ASML con tecnología luz ultravioleta extrema (UVE) de alta AN (apertura numérica) irán a las instalaciones de Samsung Electronics en Corea del Sur.

De este modo, la compañía asiática competirá por la carrera de los chips contra Intel, otra de las primeras compañías en recibir este tipo de maquinaria para la fabricación de chips con litografías punteras.



Samsung ya daba la batalla por perdida, ya que en la carrera por el liderazgo en la fabricación de chips, Intel y TSMC habían invertido grandes cantidades de dinero para poder avanzar más rápidamente. Sin embargo, un cambio en la compañía ha hecho que aceleren su proceso de actualización y se

invierta más dinero para la llegada de estos equipos desde Países Bajos. Gracias a la fotolitografía UVE de óptica de alta AN, Samsung será capaz de fabricar chips semiconductores con transistores más pequeños y con mejores características.

Esta alta apertura numérica se refiere al ancho del haz que se emite contra la oblea, siendo más pequeño cuanto mayor sea la apertura numérica. En los sistemas UVE la AN se ha aumentado de 0.33 en los sistemas de NXE de ASML a los 0.55 en los sistemas EXE, mejorando sus características, y aumentando la densidad de transistores hasta un 190 % con una reducción de su consumo.

Vía: DigiTimes.